

株式情報

平成19年3月31日現在

発行可能株式総数	102,000株
発行済株式総数	25,737株
株主数	3,002名

■大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
富加津 好夫	4,665	18.12
株式会社エー・アンド・デイ	2,698	10.48
宮内 栄	790	3.06
新田 純	680	2.64
生江 隆男	500	1.94
富加津 英夫	500	1.94
崎山 武美	464	1.80

会社概要

平成19年3月31日現在

会社名	株式会社ホロン (HOLON CO.,LTD.)
所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-5 新宿土地建物第11ビル3F TEL：03-3341-6431(代)
設立	昭和60年5月
資本金	5億8,974万円
代表者	富加津 好夫
従業員数	48名
事業内容	半導体検査装置の開発、 製造、販売、保守サービス

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
売買単位	1株
株主名簿管理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
同事務取扱所	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 TEL：0120-78-2031 (フリーダイヤル)
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店

役員

平成19年6月27日現在

代表取締役社長	富加津 好夫
常務取締役	穴澤 紀道
取締役	崎山 武美
取締役	新田 純
取締役	松方 清彦
取締役	安宅 正志
取締役	加藤 邦彦
取締役	小林 賢一
常勤監査役	生江 隆男
監査役	有賀 益千代
監査役	三澤 順一

※監査役 有賀益千代及び三澤順一は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

会社情報、IR情報は、ホームページでご覧いただけます。▶▶▶ <http://www.holon-ltd.co.jp/>





代表取締役社長

富加津 好夫

ホロンのものさしは
ナノメートル。
見えない世界を測ります。

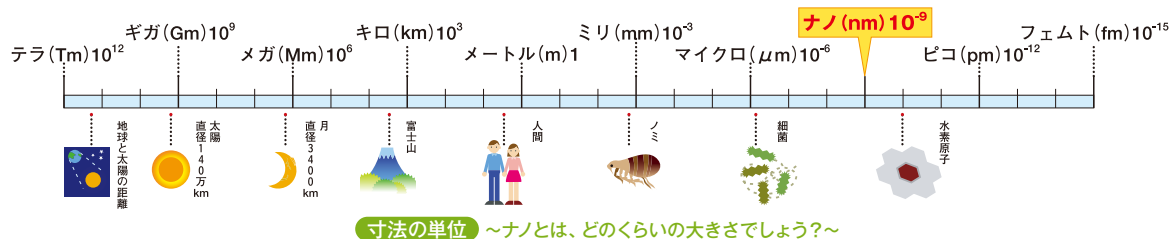
株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご支援、ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当期における半導体産業は、パソコンの伸び悩みはあるものの、自動車や薄型テレビ、携帯電話などに支えられ、安定成長を続けております。しかしながら、当社が参画しておりますマスクCD-SEM市場は、65nmノード対応機が一巡し次世代45nmノード対応機導入準備期間が予想以上に長期化し、市場全体が停滞する状況のまま推移いたしました。その結果当社は、当初計画していた経営成績を達成することができず赤字決算となりました。

このような状況のもと、当社の主力製品であるマスク用寸法測定装置EMU-270は、当期さらに性能アップに成功し、高性能化・高付加価値化を実現し商品力の強化は万全となり、今後の販売計画拡大の準備が整ったものと考えております。また、新製品としてLED生産用パターン転写装置EBLITHOの開発を行い、製品化に成功し、当社のラインナップの一部に組み入れることになりました。

今後も、当社が得意とする電子ビーム技術を軸として、新たな製品を開発し、複数製品の製造・販売による経営の向上を図るよう努めてまいります。そして、当社の総力を結集して製品性能の向上・新製品の開発にまい進することによって世界の科学技術の発展に貢献し、企業価値を高めて株主の皆様への期待に応えて行くよう尽力する所存です。

株主の皆様におかれましては、引き続き、より一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



CONTENTS

株主の皆様へ	1	財務諸表(要旨)&業績報告	5-6
商品ラインナップ・HISTORY	2	株式情報、株主メモ、会社概要、役員	裏表紙
事業内容・業界環境・今後の戦略	3-4		

微小寸法測定装置 EMU-270

EMU-250/260 (65nm対応)の後継機種、45nmに対応するEMU-270を開発いたしました。より厳しくなるチャージアップ対策として新たに「Wind方式」※を採用し、エッチング後のレジストマスクを含むすべてのマスクを安定して計測でき、測定再現性などの性能を向上させました。
※Wind方式とは、チャンバー内の圧力を高く保ち、一定の風「Wind」を与えることによりチャージを抑制する方式です。



超解像欠陥検査装置 DIS-05

DIS-05は、設計パターンとマスクに描画されたパターンの違いを検出したり、マスクに描画された同一パターンの比較を行うことによって形状の差を検出し、欠陥の有無を判定する装置です。当社として、従来にはない新たな市場を狙った新製品です。



LED生産用パターン転写装置 EBLITHO

LED(発光ダイオード)市場をターゲットとし、ステンシルマスクを利用した低加速電子ビーム高速転写装置です。当社は既に、ステンシルマスクの検査装置(EST-300)を手がけており、当社が保有する低加速電子ビームをコントロールする技術を利用した製品です。



HISTORY

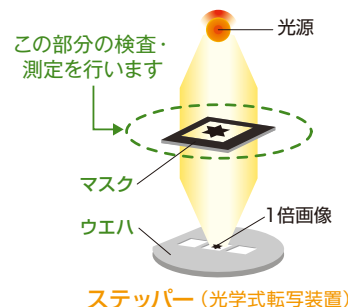
1985年5月	東京都新宿区に(株)ホロンを設立(資本金3,300万円)
1986年10月	電子ビーム微小寸法測定装置(ESP-11)を開発・発表
1996年3月	埼玉県所沢市に新設・移転
1998年12月	テクニカルセンターを東京都狛江市から埼玉県所沢市に新設・移転
1999年1月	EMU-200を海外に出荷開始
2003年7月	第三者割当増資(資本金3億8,705万円)
2004年4月	韓国支店を開設
2005年2月	JASDAQ上場(資本金5億8,595万円)
2005年8月	DIS-05を開発・発表
2006年11月	EBLITHOを開発・発表

事業内容

半導体の回路寸法を、電子ビームによって測定する検査装置の開発、製造、販売、保守サービス

当社では、小型化が進むパソコン、携帯電話、カーナビゲーションシステム、デジタル家電などの機器に不可欠な半導体が、設計どおり作られているかどうかを検査・測定する装置を開発・製造・販売致しております。

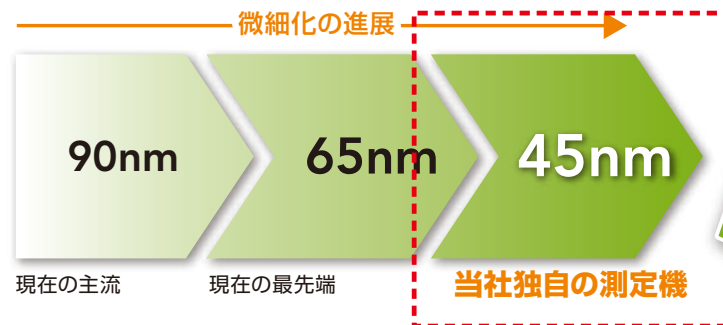
当初、ウエハ上に作られたパターン寸法を測る装置を年間20~30台作り世界中に出していました。その後、メインをマスクの寸法を測る装置へと切り替えました。これが現在、世界で最も多く採用されているマスク用寸法測定装置EMUシリーズです。当社が得意とする技術は電子ビームをコントロールする技術です。



ステッパー (光学式転写装置)

業界環境

半導体業界において、現在一般的に作られている半導体は90nm対応製品が主流であり、65nm対応の製品は、最先端の技術として市場で扱われています。今後さらに微細化の進展により、45nm対応製品のニーズが高まり、マーケットは成長していくものと思われます。



今後の展開

1 EMUの強化

主力製品EMUの性能アップ

次々世代の32nmノード以降にも対応させるために、分解能を大幅に向上させるべく研究開発を継続しております。また、微細化する測定対象パターンを一次元から二次元的に展開して、高精度な測定を可能にし、さらには、多種複雑なパターンに対応した自動測長手法を顧客に提供し、高性能化・高付加価値化を実現して、商品力の向上を図ってまいります。

製品力の強化

競合他社を上回る性能を実現

営業力の強化

顧客ニーズへの対応を強化

2 新製品EBLITHOの新市場投入

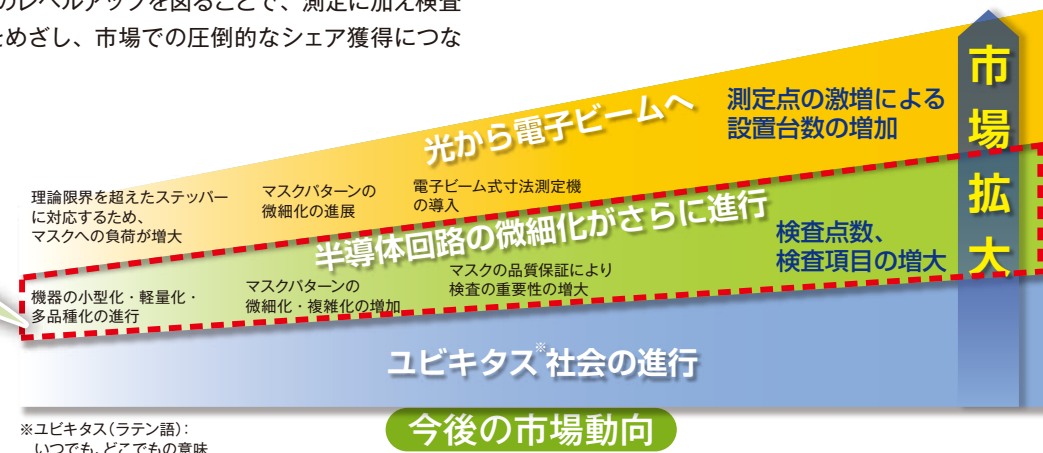
さらなる高付加価値をつけ、販促を強化

新事業領域であるLED市場へEBLITHOを開発・投入しました。本装置は当社保有の技術を利用しておりますので、低価格、高処理能力を実現しました。今後も高付加価値をつけた製品化を進め、高性能機の販促を進める計画でおります。

3 事業構造の転換

電子ビーム技術をコアとし、既存の事業領域であるマスク、ウエハ以外の事業領域も対象に加える

社員一人ひとりの電子線技術のレベルアップを図ることで、測定に加え検査のできる装置の開発の成功をめざし、市場での圧倒的なシェア獲得につなげていきたいと考えます。



※ユビキタス(ラテン語):
いつでも、どこでもの意味

● 貸借対照表

科 目	前期(第21期) 平成18年3月31日現在	当期(第22期) 平成19年3月31日現在
■ 資産の部		
流動資産	2,059	1,504
現金及び預金	844	410
受取手形	10	5
売掛金	157	262
有価証券	304	215
その他	745	611
貸倒引当金	△3	△1
固定資産	368	381
有形固定資産	300	272
無形固定資産	5	42
投資その他の資産	62	65
資産合計	2,428	1,885

新たな会計基準の導入により、貸借対照表における従来の「資本の部」の記載が「純資産の部」に変更されております。なお、前期「純資産の部」の数値につきましては、同「資本の部」の数値を組み替えて表示しております。

● 損益計算書

科 目	前期(第21期) 平成17年4月1日～ 平成18年3月31日	当期(第22期) 平成18年4月1日～ 平成19年3月31日
売上高	974	566
売上原価	538	385
売上総利益	435	180
販売費及び一般管理費	588	581
営業利益(△損失)	△152	△ 400
営業外収益	12	7
営業外費用	3	3
経常利益(△損失)	△143	△ 396
特別利益	—	1
特別損失	—	0
税引前当期純利益(△純損失)	△143	△ 395
法人税等調整額	116	3
当期純利益(△純損失)	△260	△398

単位：百万円、単位未満切捨

科 目	前期(第21期) 平成18年3月31日現在	当期(第22期) 平成19年3月31日現在
■ 負債の部		
流動負債	508	325
固定負債	208	240
負債合計	717	566
■ 純資産の部		
株主資本	1,710	1,319
資本金	585	589
資本剰余金	529	533
利益剰余金	595	196
負債純資産合計	2,428	1,885

● キャッシュ・フロー計算書

科 目	前期(第21期) 平成17年4月1日～ 平成18年3月31日	当期(第22期) 平成18年4月1日～ 平成19年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	△32	△ 452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△77	△ 79
財務活動によるキャッシュ・フロー	△139	7
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	1
現金及び現金同等物の増減額	△246	△ 523
現金及び現金同等物の期首残高	1,395	1,149
現金及び現金同等物の期末残高	1,149	625

単位：百万円、単位未満切捨

● 株主資本等変動計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日まで)

単位：百万円、単位未満切捨

	株 主 資 本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	
平成18年3月31日残高	585	529	595	1,710	1,710
事業年度中の変動額					
新株予約権の行使	3	3	—	7	7
純利益(△損失)	—	—	△398	△398	△398
事業年度中の変動額合計	3	3	△398	△391	△391
平成19年3月31日残高	589	533	196	1,319	1,319

新たな会計基準の導入により、貸借対照表中「純資産の部」における異動を分かり易く開示するため、新しい財務諸表として株主資本等変動計算書を掲載しております。

当期の概況

当期における日本経済は、自動車・鉄鋼等について中国の活発な設備投資に支えられて好調な業績を示す一部業種がありました。当社が参画しております半導体業界におきましては、マイクロソフト社のWindows Vista新製品発表、また、エルピーダを含む台湾TSMC等海外の半導体メーカーにおける活発な設備投資がありました。しかしながら、自動車用車載電子機器や薄型テレビ、携帯音楽プレーヤー等を始めとするデジタル家電の市場拡大が見られる一方、販売価格競争の激化により一部商品を除き、半導体の販売価格は一時よりは持ち直してはいるものの好調とまでは至っておりません。

このような状況のもと、当社は、主力製品である45nm用の『マスク用寸法測定CD-SEM』を半導体技術の開発ロードマップに先行し、他社に先駆け

次期業績予想

半導体業界におきましては、最新のフォトリソマスク商品である65nmノードからさらに微細な次世代フォトリソマスクである45nmノードへの開発・試作が、2008年を目指して活発化する兆候が見られます。リソグラフィプロセス機器の大型設備の投資と相まって、寸法測定装置についても設備投資が予想されております。当社の主力製品であるマスク用寸法測定CD-SEM「EMU-270」は当期の先行投資によって、顧客の要求を的確に捉えつつあります。この機会に一層の拡販を図り積極的な販売展開をしていきたいと考えております。競合他社は、65nm製品の製造に追われ、またその一部技術的問題解決の未達案件もあり、次世代最先端装置である45nmノード対応マスクCD-SEMの開発は遅れ、見込み客からは当社製品への期待が寄せられております。また、新たな競争相手の参入も視野に捉え、万全の開発体制を敷いた、成果が実る事業年度にしたいと考えております。さらに、当社の新事業として、独自の電子ビーム技術を使って新しく開発し

市場に投入して顧客への積極的な売込みを行いました。成果を見るには至らず、また、昨年11月にLED市場への電子スタンプを発売開始いたしました。が収益への貢献に至らず、当期におきましても厳しい経営環境が続き、当初計画した経営成績を達成することができませんでした。

その結果、製品事業の売上高は、前期比60.4%減少し、272百万円になりました。その他事業につきましては、前期比3.4%増加し、293百万円となりました。上記の結果、当期売上高566百万円(前期比41.8%減)、営業損失は400百万円(前期営業損失152百万円)、経常損失は396百万円(前期経常損失143百万円)、当期純損失は398百万円(前期当期純損失260百万円)となりました。

た「EBLITHO」装置をLED製造業界市場に投入した結果、受注も出はじめております。次期につきましては、ステンシルマスク等関連技術の一層の充実と顧客開拓に、また、売上拡大に積極的に邁進したいと考えております。次期の業績につきましては、売上高1,400百万円、営業利益57百万円、経常利益54百万円、当期純利益52百万円を計画しております。なお、当社の主力製品はマスク寸法測定装置であり、装置1台あたりの販売価格は非常に高額で当社の企業規模に比して大きいため業績を不安定にしております。特に、第4四半期に売上を予定している案件が翌期の計上となった場合、売上高が計画を大きく下回る可能性があることを当社の事業等のリスクとして発表させて頂いております。当社はこのリスク発生の可能性を十分に認識した上で、発生の回避もしくは発生した場合でも影響を最小限に止めるべく努力をまいります。